PRODUCTION OF 1-HEXENE

Publication number: JP10007594 Publication date: 1998-01-13

Inventor: OGURI MOTOHIRO: AOYAMA TAKAMITSU:

YAMAMOTO TOSHIHIDE; MIMURA HIDEYUKI; KOIE

YASUYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/12; B01J31/14; B01J31/22; C07B61/00;

C07C2/30; C07C2/32; C07C7/148; C07C11/107; B01J31/12; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C7/00; C07C11/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/107; B01J31/12; B01J31/14; B01J31/12;

C07C2/30; C07C2/32; C07C7/148 - European:

Application number: JP19960155804 19960617 Priority number(s): JP19960155804 19960617

Report a data error here

Abstract of JP10007594

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce 1-hexene without lowering the selectivity of the product or causing the entrainment of a deactivation agent to unreacted ethylene by trimerizing ethylene in the presence of a chromium-based catalyst and completely deactivating the catalyst with a deactivation agent in two stages. SOLUTION: Ethylene is trimerized in the presence of a chromium-based catalyst composed of a chromium compound and an alkyl metal compound. After completing the trimerization reaction, a deactivation agent is added to the liquid reaction product in an amount of >=1 molequivalent based on the chromium compound in the chromium-based catalyst and <3 mol-equivalent based on the total molar number of metals in the chromium-based catalyst to effect the deactivation of the chromium compound in the chromium-based catalyst. Thereafter, 3-2,000 mol-equivalent of a deactivation agent is added to the liquid reaction product to effect the complete deactivation of the chromium-based catalyst and obtain the objective 1-hexene useful as a comonomer for a linear low-density polyethylene or a rew material for plasticizers.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

離別記号

(51) Int.Cl.⁶

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

广内整理番州

(11)特許出願公房番号 特開平10-7594

(43)公開日 平成10年(1998) 1 月13日

技術表示條所

(OL) HILLOI.		Det Children	11 L2385-E-ML-12	1.					纹带衣不图的	
C07C	11/107		9734-4H	CO	7 C	11/107				
B01J	31/12			В 0	1 J	31/12		x		
	31/14					31/14		x		
	31/22					31/22		х		
C07C	2/30		9734-4H	CO	7 C	2/30				
			審查辦求	未請求	請以	改項の数 2	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特職平8-155804	順平8-155804			(71) 出願人 000003300				
						東ソー	株式会	社		
(22) 出顧日		平成8年(1996)6	i		山口見	新南陽	市開成町4560	器地		
				(72)	発明:	者 小栗	元宏			
						三重集	美四日市	市別名6-7	-8	
				(72)	発明	者 青山	隆充			
						三重リ	中日四月	市羽津乙129		
				(72)	発明:	者 山本	敏秀			
				İ		三取り	和日本	市別名3-5	- 1	
				(72)	発明	者 三村	英之			
						三重男	中日四月	市別名3-5	-1	
				(72)	発明	哲 鯉江	泰之			
						三重集	其	東員町城山2	-26-14	
				1						

(54) 【発明の名称】 1-ヘキセンの製造方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンを三量化して1 ーヘキセンを製造する方法において、エチレンの三量化反応に用いた高性な の方法において、エチレンの三量化反応に用いた高性が プロム系検証を大統領する際に、1 ーヘキセンの製 率を低下させることなく、また未反応エチレンに失活剤 を同样させることなく、大統領理を行うことのできる1 ーヘキセンの製売がおき提供する。

「解決手段」 三単化反応等で後、クロム系触媒に含有されるクロム化金物に対して1モル当盟以上で、しかもクロム保健域に合有される意の合計・ル教に対して3モル当量未満の失活剤を、反応生成液に添加して先ずクロム系機域に会有される全域の合計・北教に対して3・10 〇 〇 モル当県の実活剤を、反応生成液に添加してアウロム系機域に含有される金属の合計・北教に対して3・10 〇 〇 モル当県の実活剤を、反応生成液に添加してクロム系機域を完全に実活剤を、反応生成液に添加してクロム系機域を完全に実活剤を、反応生成液に添加してクロム系機域を完全に実活剤を

【特許請求の範囲】

【請求項11 クロム系触媒の存在ドにエチレンを三量化 たて1 ーペキセンを製造する方法において、三量化反応 終了後、クロム系能媒に含有されるクロム化合物に対して 1 モル当量以上で、しかもクロム系能媒に含有される 返場の合計モル放に対して 3 モルカションは大部様と 反応生成液に添加して先ずクロム系機媒に含有されるクロム化合物を失済させた後、未反応エチレンを応む基礎 がから新程、、かいてクロム系機線に含有されるを構成 合計モル製に対して3 つ 2 0 0 0 モル当量の失活剤を 反応生成液に添加してクロム系機媒等と会に大流させる ことを特徴とする1・一ペキセンの製造方法。

【請求項2】クロム系触媒が少なくとも(A)クロム化合物。(B)アルキル金塚化合物からなる触媒であることを特徴とする請求項1に記載の1-ヘキセンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【現明の紙する技術分野1 木発明は、エチレンの三量化 による1 — ヘキセンの製造方法に関する。さらに詳しく は、線状低速度がリエチレン(LLDP B1 の原料コモ ノマーや可認利服料として極かて有用な1 — ヘキセンを 高速財的に製造しうるエチレンの三亜化による1 — ヘキ センの製造方法に関する。

[0002]

「税率の妨害」エテレンを三飛化する反応において、クロ系飛銭線を用い1 へ今キセンを製造することは公知である。例えば、米国特計第3347840号列規律及役 特開昭62-265237号公報には、クロム化合物、アルミノキウエシジメトキンエラン端のエーテル化合物、切からな危機系が、特陽平6-239920号公報には、クロム化合物、ビールを有化合物、必属アルキルからな危機系が、又特間平6-59732号公報には、クロム化合物、ドド化合物及び金属アルキルからな危機系が、ア特別を一59732号公報には、クロム化合物、イミド化合物及び金属アルキルからな危機系が開来されている。

【0003】この帰途プロセスは一般た大別して、三量 化反成工程、未反成エチレン回収工程、触媒の央流工程 および限災工程、1 ーへキセンおよび溶媒の分配工程か ら成っている。ところで、これらの触媒はいずれら脱雄 活性が高いため、生成した1 ーへキセンと回共に重素化 循邦として供され、エチレンと 1 ーヘキセンとの共三量 化反応とよりで10、C14オレフィンが生成する。従 って、クロム系機関の存在下にエチレンを三量化して1 一へキセンを製造する方法においては、1 ーへキセンの選択率 を由しませるには、三量化反応条件としてエチレンが を高かればよい。即ち、高エチレン圧力、低温度にすれ ばよく、具体的には30以下の低温度にすればよい。 及び/又は130以下の低温度にすればよい。

【0004】一方、三量化反応終了後に未反応エチレン

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、三量化反応生 成物をフラッシャーに移送する前に、触媒を失活させる 方法もある。しかしながら、このような方法では、触媒 を完全に失活させるには大量の失活剂が必要となるた め、失活処理後に未反応エチレンをフラッシュさせると 使われなかった失活剤が未反応エチレンに同伴される。 従って、未反応エチレンをリサイクルして、再度三量化 反応に使用する際に、この失活剤の除去に要する新たな 装置を設置しなければならず、その費用や用役費が増大 するのは免れない。その上、そのボリマーの廃棄に時間 と労力を要するという問題があった。本発明は上記の課 題に鑑みてなされたものであり、その目的はエチレンを 三量化して1-ヘキセンを製造する方法において、エチ レンの三量化反応に用いた活性なクロム系触媒を失活処 理する際に、1-ヘキセンの選択率を低下させることか く、また未反応エチレンに失活剤を同伴させることな く、失活処理を行うことのできる1-ヘキセンの製造方 法を提供することである。

100001

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解除するための手段】本発明者も行った結果、クロス系統議 の存在下によすたシを三葉化して1~へ今センを製造する方法において、三輩化反政終丁後、反応生成派七野も る方法において、三輩化反政終丁後、反応生成派と称が、 20人派役者を訪加して、先学りの工業結構に合するため、 クロム化合物を火流させた後、未反応エチレンを反応生成が、 添加してクロム系機謀を完全に失活がを反応生成が、 添加してクロム系機謀を完全に失活させると1~ペキセンが高速以率で得られることを見い出し、本発明を完成 すると至った。

【0007】脚ち巻男朋は、クロン系機嫌の存在下にエナレンを三量化して1 一へキセンを製造する方法において、三量化反応等で後、クロム系機様に含有されるクロム化合能に対して1 モルジ皇太子 線の大統列を、反応生成版に対して3 モルジ皇本 海の大統列を、反応生成版に添加して先ずクロム系機 に含有されるクロム化合物を失活させた後、未反応エチ レンを反応生成液から分離し、次いでフロス乗機様に 合有されるクロム化合物を大活させた後、未反応エチ レンを反応生成液から分離し、次いでフロス乗機様に 着される名の合計され数に対して3-2、000モル 当量の失活剤を、反応生成液に添加してクロム系触媒を 完全に失活させることを特徴とする1-ヘキセンの製造 方法に関する。

[0008]

【発明の実施の形態】次に、本発明について更に詳しく 説明する

【0009】本発明においては、エチレンを三量化して 得られる、1-ヘキセンを含有する三量化反応生成液中 のクロム系触媒を失活させる手順が重要である。

[0010] 未売明において1一へキセンは、クロム系 触媒の存在下にエチレンを三量化させることによって得 られる、このクロム系触媒は、少なくとも(A)クロム 化合物、(B)アルキル金配合物、および所翼に応じ て用いられる(C)イミド化合物、たロール合本化合物 及びエーテル化合物からなる前より強はなた少なくとも 一種以上のヘテロ元常含有方機化合物から成っている。 [0011]本急等で使用される(A)クロム化合物と しては、特に削限するものではないが、例えば、下記一 規定(1)

CrA_nB_n (1)

(式中、 献は1~6の路数であり、 れは0~4の整数である。また人は炭素数1~20のアルキル基、アリール ある。また人は炭素数1~20のアルキル基、アリール 基、アレーン、アルコキシ基、カルボキシレート基、β -ジケトナート基、β - ケトエステル 基及びアミド基、 ハロゲン原子、ヒドロキシル基、硝酸基、硫酸素、硫酸素、 素酸基、カルボニル並びに原素からなる背より選ばれた 1種以上を表し、Bは選集舎年化合物、リン含者化合物 物、足索含化を物、アンチェシ合有化合物、配素含含 化合物及び環費含年化合物からなる群より選ばれた1種 以上を表す)で示される化合物が好遊なものとして用い られる。

【0012】上記一般式(1)において、炭素数1~2 0のアルキル基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プチル基、アリル 基、ネオペンチル基、シクロペンタジエニル基、ペンタ メチルシクロベンタジエニル拡叉はトリメチルシリルメ チル基等が挙げられる。炭素数6~20のアリール基と しては、特に限定するものではないが、例えば、フェニ ル基又はトルイル基等が挙げられる。炭素数6~20の アレーンとしては、特に限定するものではないが、例え ば、ベンゼン、エチルベンゼン又はヘキサメチルベンゼ ン等が挙げられる。炭素数1~20のアルコキシ基とし ては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基、ヘキシル オキシ基、ステアリルオキシ基又はフェノキシ基等が挙 げられる。炭素数1~20のカルボキシレート基として は、特に限定するものではないが、例えば、アセテート 基、プロピオネート基、ブチレート基、ネオペンタノエ ート基 2ーエチルヘキサノエート基 オキシー2-エ チルヘキサノエート基、イソオクタネート基、ジクロロ

エチルヘキサノエート基、ラウレート基、ステアレート 基、オレエート基、ベンゾエート基、又はナフテネート 基等が挙げられる。炭素数1~20のβ-ジケトナート 基としては、特に限定するものではないが、例えば、ア セチルアセトナート基、トリフルオロアセチルアセトナ ート基。 ヘキサフルオロアセチルアセトナート基 2. 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト基、1,3-ブタンジオナート基、2-メチル-1. 3-ブタンジオナート基、ベンゾイルアセトナート基等 が挙げられる。炭素数1~20のβ-ケトエステル基と しては、特に限定するものではないが、例えば、アセチ ルアセテート基等が挙げられる。アミド基としては、特 に限定するものではないが、例えば、ジメチルアミド基 又はジシクロヘキシルアミド基が挙げられる。ハロゲン 原子としては、特に限定するものではないが、例えば、 フッ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。上記一般 式(1)において、窒素含有化合物としては、特に限定 するものではないが、例えば、アミン、ピリジン、アミ ド、又はニトリル等が挙げられる。アンチモン含有化合 物としては、特に限定するものではないが、例えば、ト リアリールアンチモン、又はトリアルキルアンチモン等 が挙げられる。リン化合物としては、特に限定するもの ではないが、例えば、ホスフィン、ホスファイト、又は ホスフィンオキシド等が挙げられる。酸素含有化合物と しては、特に限定するものではないが、例えば、水、毎 水カルボン酸、エステル、エーテル、アルコール又はケ トン等であり、硫黄含有化合物としては、特に限定する ものではないが、例えば、二硫化炭素、スルフォン、チ オフェン、又はスルフィド等が挙げられる。 【0013】上記一般式(1)で示されるクロム化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、クロ ム(II) ジメチル、クロム(III) トリメチル、ク ロム(IV)テトラメチル、クロム(III)トリス (カーアリル) . ニクロム(II) テトラキス(カーア リル)、クロム(IV)テトラキス(ネオペンチル)、 クロム (IV) テトラキス (トリメチルシリルメチ ル)、クロム(II) ビス(シクロペンタジエニル)。 クロム (II) ピス (ペンタメチルシクロペンタジエニ ル)、クロム(III)トリス(π-アリル)、クロム (IV) テトラキス(π-アリル)、クロム(II) ジ フェニル、クロム(0)ビス(ベンゼン)、クロム(1 I) ジフェニル (ベンゼン)、クロム(O) ビス(エチ ルベンゼン)、クロム(0)ビス(ヘキサメチルベンゼ ン)、クロム(I)シクロペンタジエニル(ベンゼ ン)、クロム(IV)テトラメトキシド、クロム(I V) テトラエトキシド、クロム (IV) テトラプロポキ シド、クロム(IV)テトラブトキシド、クロム(I V) テトラヘキシルオキシド、クロム (IV) テトラス テアリルオキシド、クロム (I V) テトラフェノキシ

ド、クロム(II) ビス(アセテート)、クロム(II

 トリス (アセテート)、クロム (II) ビス (プロ ピオネート)、クロム(III)トリス(プロピオネー ト)、クロム(III)トリス(ブチレート)、クロム (II) ビス(2-エチルヘキサノエート). クロム (I I I) トリス (2-エチルヘキサノエート)、クロ ム(II) ビス(イソオクタネート)、クロム(II I) トリス (イソオクタネート)、クロム (III)ト リス (オキシー2-エチルヘキサノエート)、クロム (| | | |) トリス (ジクロロエチルヘキサノエート)、 クロム (I I I) トリス (ネオペンタノエート) . クロ ム(II) ピス(ネオペンタノエート)、クロム(II I) トリス (ラウレート)、クロム (II) ビス (ラウ レート)、クロム(III)トリス(ステアレート)、 クロム(II) ビス(ステアレート)、クロム(II I) トリス (オレエート) , クロム (II) ビス (オレ エート)、クロム(III)トリス(ベンゾエート)、 クロム (I I) ビス (ナフテネート) 、クロム (I I I) トリス (ナフテネート)、クロム (II) オキザレ ート、クロム (II) ピス (アセチルアセトナート). クロム (I I I) トリス (アセチルアセトナート) . ク ロム(III)トリス(トリフルオロアセチルアセトナ ート)、クロム(III)トリス(ヘキサフルオロアセ チルアセトナート)、クロム(III)トリス(2. 2.6.6-テトラメチルー3,5-ヘプタンジオナー ト)、クロム(III)トリス(1、3-ブタンジオナ ート)、クロム(III)トリス(2-メチル-1,3 ーブタンジオナート)、クロム(III)トリス(ベン ゾイルアセトナート)、クロム(III)トリス(アセ チルアセテート)、クロム(111)トリス(ジメチル アミド)、クロム(III)トリス(ジシクロヘキシル アミド)、フッ化第一クロム、フッ化第二クロム、塩化 第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化第 ニクロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、塩化 クロミル、過塩素酸クロム、二塩化ヒドロキシクロム、 硝酸クロム、硫酸クロム等が挙げられる。

(0014) きるに、トリクロロトリアエリンクロム (III)、ジクロロビス (モリジン) クロム (I I)、ジクロロビス (4-エチルセリジン) クロム (I I)、トリクロロトリモリジンクロム (III)、トリ クロロトリス (4-イソプロセルセリジン) クロム (I II)、トリクロロトリス (4-フェニルセリジ ン) クロム (III)、トリクロロ (1,4、アートリ メチルー1、4、アートリア・ジクロノナン) フロム (III)、ジクロロジニトロシルビス (4-エチルゼ リジン) クロム (III)、ジクロロジニトロシルビス (IV)フェニルエスフィンオキンド) クロム (III)、ジクロロビス (トリフェニルエスフィンオキンド) クロム (III)、トリクロロトリス (トリフェニルホスフィ ン) クロム (III)、トリクロロドンティルホスフィン) クロム (III)、トリクロロトリス (トリフェニルホスフィン

[0015] ごれらのうち駅り扱いやすさ及び安定性の 繭から、カルボキシレート基を有するクロムカルボキシ レート化合物板びタージケトナート起き有するクロムタ ージケトナート低合物が背よしく用いられる。より貸ま しくは、クロム(III)トリス(2ーエチル・チート)、 クロム(III)トリス(ドフテネート)、 クロム(III)トリス(トフトナート)、ク ロム(III)トリス(トフトナート)、ク トリス(トフトリス(トフトナート)、ク トランチルー3、5ーヘブタンジオナート)が用いられ また、上記プロム化舎物はそれぞれ単独で使用し得 るのならず、二種以上を混合して用いることも可能で ある

【0016】本発明において使用される(B)アルキル 金属化合物は、特に限定するものではないが、例えば、 下記一般式(2)

(2)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であっ て、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは

R,MX.

、ネシウム、亜部、ボロンスはアルミニウムを美し、Rは 炭素敷1~10のアルキル基より超ばれた1種以上を表 し、入は水銀加子、アルコキシ高、アリール基及の ゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示 される化合物、又はアルミノキサンが好遊なものとして 挙げられる。

【0017】上記一般式(2)において、炭素敷し~1 のアルキル基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル 基、シクロヘキシル基、Xはオクチル基等が挙げられる。 、アルコキシ基としては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ基、アトキシ基、アトキシ基、アトキシ基、アトキン基、アトキン基、 はフェノキシ基等が挙げられる。アリール基としては、 特に限定するものではないが、例えば、フェニル基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するものではなが、例えば、フェニル基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するもの ではないが、例えば、ファ素、塩素、臭素、又はヨウ素 が挙げられる。

【0018】なお、上記一般式 (2) において、MがA Iで、pとqがそれぞれ1.5のとき、AIR_{1.5}X_{1.5}

となる。このような化合物は 理論的には存在しない が、通常、慣用的にA I₂R₃X₃のセスキ体として表現 されており、これらの化合物も本発明に含まれる。 【0019】上記一般式(2)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロビルリチウム、 n-ブチルリチウム、 s-ブ **チルリチウム、**tーブチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルポラン、トリエ チルボラン トリメチルアルミニウム トリエチルアル ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリーローへ キシルアルミニウム、トリーn-オクチルアルミニウ ム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシク ロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウ ムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリ ド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミ ニウムジクロリド等が挙げられる。

【0020】本売駅において使用されるアルミノキウンとは、前窓のアルキルアルミンの人化合物と大とを一定 範囲内の重比で反応させて得られる加水分解生成物である。アルキルアルミニウム化合物を加水分解する方法で る。アルキルアルミニウム化合物を加水分解する方法で 成できる。例えば、(1)アルキルアルミニウム化合物 そのまま、又は有機市媒への希訳育窓に水を接触させる 方法、(2)アルキルアルミニウム化合物と極化マグネ シウム・6水塩、経酸サ、7水塩、脱酸原・5水塩等の の端辺の結晶形と反応させる方法、多体係のはは、前記特部間62-2652379公標や特間昭 62-148491号公解に開示されている。加水分解 を行う窓のアルキルアルミニウム化合物と水とのモル比 は1:0、4~1:1.2、釘ましくは1:0.5~ 1:1.0である。

【0021】これらのアルキル金属化合物のうち入手の 容易さ及び活性の面からトリエチルアルミニウムやトリ イソブチルアルミニウムが好ましく用いられる。これら のアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、 二種以上を混合して用いることも可能である。

【0022】さらに、所望に応じて用いられる(C)へ テロ元素を有再機化合物としては、イミド化合物、ピロ ール音有化合物及びエーテル化合物からなる群より選ば れた少なくとも一種以上の化合物が挙げられる。イミド 化合物としては、イミド権適を有する化合物であればい

かなる化合物でもよく、特に制限はないが、例えば、マ レイミド、1-クロロエテン-1、2-ジカルボキシイ ミド、1-プロモエテン-1,2-ジカルボキシイミ ド、1-フルオロエテン-1、2-ジカルボキシイミ ド、1-トリフルオロメチルエテン-1、2-ジカルボ キシイミド、1,2-ジクロロエテン-1,2-ジカル ボキシイミド、シトラコンイミド、2-プテン-2、3 -ジカルボキシイミド、1-シクロペンテン-1、2-ジカルボキシイミド、スクシンイミド、α、α-ジメチ **ルーβ-メチルスクシンイミド、α-メチル-α-アロ** ピルスクシンイミド、グルタルイミド、3,3-ジメチ ルグルタルイミド、ベメグリド、フタルイミド、3、 4.5.6ーテトラクロロフタルイミド、1.2ーシク ロヘキサンジカルボキシイミド、1,2,3,6-テト ラヒドロフタルイミド、1,2,3,4-テトラヒドロ フタルイミド、3、4、5、6ーテトラヒドロフタルイ ミド、1,8-ナフタルイミド、2,3-ナフタレンジ カルボキシイミド、シクロヘキシイミド、N-クロロス クシンイミド、Nープロモスクシンイミド、N-ヨード スクシンイミド、N- (メトキシカルボニル) マレイミ ド、N-(ヒドロキシ)マレイミド、N-(カルバモイ ル) マレイミド等のイミド類が挙げられる。

【0023】さらに、N-(トリメチルシリル)マレイ ミド、N-(トリメチルシリル) コハクイミド、N-(トリメチルシリル)シトラコンイミド N-(トリメ チルシリル) -2-ブテン-2, 3-ジカルボキシイミ ド、N--(トリメチルシリル)-1-シクロペンテン- 2ージカルボキシイミド、N-(トリメチルシリ ル) -3, 4, 5, 6-テトラヒドロフタルイミド N - (トリメチルシリル)スクシンイミド、N- (トリエ チルシリル) マレイミド、N-(トリーn-プロピルシ リル) マレイミド、N-(トリーローブチルシリル) マ レイミド Nー (トリーローヘキシルシリル) マレイミ ド、N-(トリベンジルシリル)マレイミド、N-(n ープチルジメチルシリル) マレイミド、N-(t-ブチ ルジメチルシリル) マレイミド、N-(ジメチルゼキシ ルシリル) マレイミド、N-(n-オクチルジメチルシ リル) マレイミド、N-(n-オクタデシルジメチルシ リル) マレイミド、N-(ベンジルジメチルシリル) マ レイミド、N-(メチルジブチルシリル)マレイミド、 N- (フェニルジメチルシリル) マレイミド、N-(p -メトキシフェニルジメチルシリル) マレイミド、N-(p-トルイルジメチルシリル) マレイミド、N-(ト リフェニルシリル) マレイミド、N-(トリプチルチ ン) マレイミド、N-(トリオクチルチン) マレイミ ド、N- (ジイソブチルアルミニウム) マレイミド、N (ジエチルアルミニウム)マレイミド、水銀マレイミ ド、鞮マレイミド、カルシウムマレイミド、カリウムマ レイミド、ナトリウムマレイミド、リチウムマレイミド 等の金属イミド類が挙げられる。

【0024】ここで、金属イミドとは、イミドから誘導 される金属イミド、あるいはこれらの混合物であり、具 体的にはイミドとIA族、IIA族、IB族、IIB 族、IIIB族及びIVB族から選択される金属との反 応により得られるイミド化合物である。この金属イミド 化合物の合成法は、特に限定するものではなく、公知の 方法で含成できる。例えば、IA及びIIA族金属のイ ミド化合物は、リチウム、ブチルリチウム、ナトリウ ム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、臭化メチルマ グネシウム、塩化ブチルマグネシウム等のIA及びII A族金属化合物とイミド化合物を反応させることで合成 できる。又、IB及びIIB金属のイミド化合物は、硝 酸銀、塩化銀、塩化水銀等のIB及びIIB金属化合物 とイミド化合物をアルカリの存在下で反応させることで 合成できる。IIIB及びIVB族金属のイミド化合物 は、トリメチルシリルクロリド、トリブチルシリルクロ リド、トリプチルチンクロリド、ジエチルアルミニウム クロリド等のIIIB及びIVB族の金属塩化物とイミ ド化合物をアルカリの存在下で反応させたり、前記の I IIB及びIVB族の金属塩化物とIA. IIA. I B、IIB族の金属イミド化合物を反応させたり、又、 トリプチルチンヒドリド、トリイソブチルアルミニウム ヒドリド等のIIIB及びIVB族の金属ヒドリドとイ ミド化合物を反応させることで合成できる。具体的に は、Polymer Journal, 24, 679 (1992) によれば、N-(トリアルキルシリル) マ レイミドは、マレイミド又は銀マレイミドとトリアルキ ルシリルクロリドを3級アミン化合物存在下で反応さ せ、次いで蒸留または再結晶して合成される。また、J ournal of Organic Chemistr ソ、39、21(1974)によれば、銀マレイミド は、マレイミドと硝酸銀をエタノール/ジメチルスルホ キシド中で苛性ソーダ存在下で反応させて合成される。 【0025】ピロール含有化合物としては、ピロール環 構造を有する化合物であればいかなる化合物でもよく、 特に制限はないが、例えば、ピロール、2,5-ジメチ ルビロール、3,4-ジメチルビロール、2,4-ジメ チルー3-エチルピロール、3,4-ジクロロピロー ル、2、3、4、5ーテトラクロロビロール、2ーアセ チルピロール、3-アセチル-2,4-ジメチルピロー ル、ピロール-2-カルボン酸、ピロール-2-カルボ キサルデヒド、エチルー2、4-ジメチルー5ー(エト キシカルボニル)-3-ピローループロピオネート、エ チルー3,5ージメチルー2ーピロールカルボキシレー ト、テトラヒドロインドール等のピロール、リチウムビ ロリド、ナトリウムビロリド、カリウムビロリド、セシ ウムピロリド、ジエチルアルミニウムピロリド、エチル アルミニウムジビロリド、アルミニウムトリビロリド、 ジイソプチルアルミニウムピロリド ナトリウムーク 5-ジメチルピロリド、カリウム-2、5-ジメチルピ

ロリド、セシウムー2、5 -ジメチルピロリド、ジェチルアルミニウムー2、5 -ジメチルピロリド、エチルア ルアルミニウムビス (2、5 -ジメチルピロリド)、ア・ ニウムトリス (2、5 -ジメチルピロリド)、ジイソブ チルアルミニウムー2、5 -ジメチルピロリド等の金属 ピロリドが解析される。

【0026】エーテル化合物としては、エーテル結合を 有する化合物であればいかなる化合物でもよく、特に制 隠はないが、例えば、ジエチルエーテル ジブチルエー テル、テトラヒドロフラン、ピラン、ジメトキシエタ ン、ジエトキシエタン、ポリエチレングリコール、ポリ プロピレングリコール等が挙げられる。これらのうち活 性の面から、マレイミド、N-(トリメチルシリル)マ レイミド、ピロール、2,5-ジメチルピロール、ジメ トキシエタンが好ましく用いられる。また、これらヘテ 口元素含有有機化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみ ならず、二種以上を混合して用いることも可能である。 【0027】本発明における。前記(A)クロム化合 物、(B)アルキル金属化合物、及び必要に応じて用い る(C) ヘテロ元素含有有機化合物の混合割合は、 (A) クロム化合物1モルに対して、(B) アルキル金 属化合物は通常、0.1~10.000当量であり、好 ましくは3~3,000当量、より好ましくは10~ 2,000当量である。また、必要に応じて用いる (C) ヘテロ元素含有有機化合物の使用量は、(A) ク ロム化合物1モルに対して通常、0.1~1,000当 量であり、好ましくは0.5~500当量、より好まし くは1~300当量である。本発明のクロム系触媒は、 前記の(A)クロム化合物。(B)アルキル金属化合物 及び必要に応じて(C)へテロ元素含有有機化合物を原 料として、溶媒中で接触させることにより調製できる。 接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応原 料であるエチレンの存在下に(A)クロム化合物。 (B) アルキル金属化合物及び(C) ヘテロ元素全右右 機化合物を接触させて触媒を調製し、接触と同時に三量 化反応を開始する方法、または(A)クロム化合物、 (B) アルキル金属化合物及び(C) ヘテロ元素含有有 機化合物を前もって接触させて触媒を調製した後、エチ レンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。な お、これらの原料の混合順序は特に制限はされない。 【0028】この触媒系を測製する際の、クロム化合物 の濃度は特に制限されないが、通常溶媒1リットルあた り、0.001マイクロモル~100ミリモル、好まし くは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用 される。またここで用いられる溶媒としては 例えげ ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘアタン、オクタン、イ ソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロ ヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デ カリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キ シレン、エチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、ジ

クロロベンゼン等の方希族紀代水素類及60届化メナレ 、クロロホル人、関塩化炭素、ジクロロエタン等の塩 素化炭化水素類が等けられる。また皮皮原料のオレフィ ンそのもの、あるいは反応生成物、例えば、ブテン、1 一へキセン、オクテン、デセン、ドデセン等のオレフィ メ類を演集して限いることもできる。これらの流媒は それぞれ事後で使用し得るのみならず、二種以上を混合 して用いることも可能である。ここで、触媒調整時の触 媒綱度をコントロールする目的で、必要に応じて議論や 希釈じる赤足と支ない。

【0029】また、クロム化合物、アルキル金属化合物 及びヘテロ元素有機化合物を接触させる際の温度は通常 -100~250℃、好ましくは0~200℃である。 触媒系の測製時間は特に制限されず、通常0分~24時 間、好ましくは0分~2時間である。なお、触媒調製の すべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ま しい。また、触媒調製原料および溶媒は十分に乾燥して おくことが好ましい。本発明によれば、上記の如く調製 されたクロム系触媒に、所望に応じて更に、塩素、臭 素、ヨウ素、ブチルクロリド、アミルクロリド、ヘキシ ルクロリド、ヘプチルクロリド、オクチルクロリド、ノ ニルクロリド、デシルクロリド、ラウリルクロリド、メ チルブロミド、プロビルブロミド、ブチルブロミド、ア ミルブロミド、ヘキシルブロミド、エチルヘキシルブロ ミド、ノニルプロミド、セチルブロミド、ジプロモメタ ン、ジクロロエタン、ジブロモエタン、ジクロロブテ ン、シクロヘキシルブロミド、クロロホルム、四塩化炭 化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、プロモベ ンゼン、ジブロモベンゼン、塩化ナトリウム、塩化カリ ウム、塩化セシウム、塩化マグネシウム、塩化亜鉛、臭 化亜鉛、ヨウ化亜鉛、三塩化ホウ素、三臭化ホウ素、三 塩化アルミニウム、三臭化アルミニウム、四塩化ケイ 素、四塩化ゲルマニウム、四臭化ゲルマニウム、塩化第 ースズ、塩化第二スズ、ヨウ化スズ、三塩化リン、五塩 化リン、三塩化アンチモン、五塩化アンチモン、三臭化 アンチモン、三フッ化アンチモン、五フッ化アンチモ ン、ジメチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニ ウムブロミド、ジメチルアルミニウムアイオダイド、ジ エチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブ ロミド、ジエチルアルミニウムアイオダイド、エチルア ルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムジブロミ ド、エチルアルミニウムジアイオダイド、ジイソアロビ ルアルミニウムクロリド、ジイソプチルアルミニウムク ロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド、ジヘキシ ルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウ ムクロリド、ジオクチルアルミニウムクロリド、メチル アルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセス キクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、トリ メチルシリルクロリド、トリメチルシリルプロミド、ジ メチルシリルジクロリド、メチルシリルトリクロリド、

フェニルシリルトリクロリド、ジフェニルシリルジクロ リド、メチルジクロロシラン、トリブチルチンクロリ ド、ジブチルチンジクロリド、ブチルチントリクロリ ド、トリフェニルチンクロリド、ジフェニルチンジクロ リド、フェニルチントリクロリド等のハロゲン化物やト リス (2-フルオロフェニル) ボロン、トリス (3-フ ルオロフェニル) ボロン、トリス (4-フルオロフェニ ル) ボロン、トリス(2,4-ジフルオロフェニル) ボ ロン、トリス(2,5-ジフルオロフェニル)ボロン、 トリス(2,6-ジフルオロフェニル)ボロン、トリス (2, 4, 5-トリフルオロフェニル) ボロン、トリス (2, 4, 6-トリフルオロフェニル) ボロン、トリス (ペンタフルオロフェニル) ボロン、ビス (ペンタフル オロフェニル) 亜鉛、トリス (ペンタフルオロフェニ ル) アルミニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ゲルマニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル)スズ、トリス(4-トリフルオロメチルフェニル) ボロン等のルイス酸を添加し、クロム系触媒として供さ れる。ハロゲン化物やルイス酸の共存により触媒活件の 向上やポリマーの副生を抑制する等の効果が認められ る.

[0030] このようにして衝撃されたクロム系独域を 用いてエチレンの三量化反応が行なわれる。本発明においてクロム系独域や使用量は対能に制度もなたいが、 第 、前記海媒で希釈し、三量化反応後1リットルあた り、クロム化合物が0、001マイクロモル~1003 リモル、がましくは0、01マイクロモル~103リモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活形が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では、練経活性が増やしず経済的でない。

【0031】本等原における三量化反応の温度は、通常 一100~250℃あるが、併ましては0~200℃ である。反応圧力は、絶対圧で通常の~3000kg/c mであり、併ましては0~150kg/c mであり、 がまた、反応時間は歳を仕力に左右され、一概に決める ととはできないが、通常5秒~6時間である。また、エ ナレンは、前記の圧力を保つように走絶的に係治しても よいし、反応開始時に前記比力で対人して反応させても よい、原料ガスであるエナレンには、反応に不溶性な力 何ら差しまえない。なお、三量化反応のすべつ時候は、 交流と水分を置けて行うことが望ましい。また、エナレ ンは十分化を能しておくことが望ましい。また、エナレ ンは十分化を能しておくことが望ましい。また、エチレ ンは十分化を能しておくことが望ましい。また、エチレ

【0032】本等別においては、エチレンの三量代反応 によって得られる反応生成法に敗域の火活剤を参加して 重量化反応を作出させる場合の火活剤の添加方法が重要 である。即ち、前記のようにして得られた三量化反応生 成液を、例えばフラッシャーに供給して未反応エケン を回収する前数において機製を活を行う。

【0033】本発明の未反応エチレンの回収前に行うク

ロム系触媒に含有されるクロム化合物の失活処理は、反 応生成液に、クロム化合物と反応可能な化合物を添加す ることにより行われる。このクロム化合物と反応可能な 化合物としては、特に限定するものではないが、プロト ン性化合物が挙げられ、例えば、水、及びメタノール、 エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノー ル、オクタノール、2-エチルヘキサノール、シクロヘ キサノール、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、ベンジルアルコール等のアルコール類、フェノー ル、クレゾール等のフェノール類及び酢酸、プロピオン 酸、オクチル酸、2-エチルヘキサン酸等のカルボン酸 類、アンモニア又はメチルアミン、エチルアミン、プロ ピルアミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシル アミン、シクロヘキシルアミン、オクチルアミン、アニ リン、ジメチルアミン、シエチルアミン、ジフェニルア ミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチ ルアミン、ジエチルアニリン等のアミン類、ピリジン、 ピコリン等の複素環式窒素化合物が挙げられる。これら のうち取り扱い易さの面から、水やアルコール類が好ま しく用いられる。この失活剤は単独で使用し得るのみな らず、二種以上を混合して用いることも可能である。 【0034】このクロム化合物と反応可能な化合物の使 用量は、三量化反応の触媒として用いるクロム系触媒の 共三量化活性を失わせるに十分な量で、クロム系触媒に 含有されるクロム化合物に対して1モル当量以上で、し かもクロム系触媒に含有される金属の合計モル数に対し ロム系触媒に含有されるクロム化合物に対して2モル当

100341 このプロ化舎物と及めの脚窓化舎物の使 無量は、三葉化反応の触媒として用いるプロム系機媒の 共三量化活性を失かせるに十分な量で、クロム系機媒の 含有されるプロル合物性が出して1 モル当豊以上でし かもクロム系機媒に含有される金属の合計モル教に対して 3 モル当量未満の制合で使用される。辞ましくは、ク 以上、クロム系機媒に含有される金属の合計モル教に対して ま以上、クロム系機媒に含有される金属の合計モル教に 切して2、5 モル当量未満の動物で使用量がクロム系機媒に含 有されるクロム化合物に対して1 モル当量未満ではクロ ん化合物を反応可能な化合物の使用量がクロム系機媒に含 有されるクロム化合物に対して1 モル当量未満ではクロ た1 ーペキセンはさらに三量化反応の原料として消費さ れ、C10やC14オレフィンに実験者が11ー4セン 送収率の低下につながる。またクロム系機媒に含有さ れる金融の合計セル機に対して3 モル当量より多い量で はフラッシェ後の未反応エナルと大洗剤が同用され、 未反応エチレンのリサイクルに支持がでて舒ましくな い

100351 この未反応エチレンの同収前に行うクロム 系数域に合有されるクロム化合物の失活処理の温酸は、 特に制限はされないが、通常、50℃以上、好ましくは 85~180℃、より数ましくは100~130℃であ 6、2のうち反配施度を85で以上保険すると、 地上たポリマーが反応生成液中に溶験し、副生したポリマーを系が小取り出すことなく、また火活処理のの反応 器、制御弁、部営、ボンマ等の披置を消まらせることな く、変変に失活処理を行うことができる。この失活処理 の圧力は、特別観音なないが、者ましくは反応等の に対し、 力下でする。また失活処理時間は温度や圧力に左右さ れ、一概に決めることはできないが、通常5号~1時間 である。また失活剤の添加時期は、フラッシャーに三量 化反応生成液を供給する直前に、失活剤を三量化反応生 成液に供給するのが、共二量化反応を即制するためにも 材ましい。

【0036】本売明においては、このようにして得られ たクロム系機謀に含有されるクロム化合物が失活した反 水生成液をフラッシャーに供給して未反応エチレンの分 種を行なう。未反応エチレンの分離操作は、反比生成液 の雰囲気圧力を、三量化反応時の圧力よりも低くするこ とにより行うことができる。この分離操作の温度および 時間の条件は特に制度されない。

[0038]本規則のクロス素触媒を完全に失活させる た活剤の使用量は、触媒を学をに火焼させるに十分な量 で、連常触媒に含有される金属の合計モル数に対して、 3~2、000セル当量であり、好ましくは5~1、0 のモル当量であり、失活剤の使用量が3年ル当量未満 では活性をクロル系触媒を完全に火焼することができ ず、未洗拠し駅の砂板型工程において問題が生する。 逆に失活剤の使用量が2、00モル当業より大きい量 では、失活が火質的に終了しており、これ以上の効果は 発現せず、接続物でない。

【0039】また所望に応じて失活剤に含窒素化合物や 無機化合物を協加することができる。 触媒中にハロゲン が含まれる場合、失活処理時に触媒中のハロゲンの一部 が生成オレフィンに付加して有機ハロゲン化物を少量生 成することがあるが、含窒素化合物や無機化合物の共存 によりこの有機ハロゲン化物の生成を抑制する等の効果 が認められる。

【0040】 含窒素化合物としては、特に限定するもの ではないが、例えばアンモニア又はメチルアミン、エチ ルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルア ミン、ヘキシルアミン、シロへキシルアミン、オクチ ルアミン、アニリン、ジメチルアミン、シエチルアミ ン、ジフェニルアミン、トリエチルアミン、トリエチルアニソン等のアミン、トリブナルアミン、ジエチルアニリン等のアミン類、ビリジン、ヒコリン等の房本販売業務に舎物が呼げられる。これとのうち取り扱い易さや経済性の面が大きなでして、アンモニアが発達して用いられる。この含質素化合物は特徴で使用し得ものみならず、正理以上を混合して用いることも可能である。また無概化合物としては、特に限定するものではないが、例えば木穂化アトリウム、水酸化カリウムが寄存られる。これらのうち取り扱い場合や経済性の面から、水酸化ナトリウムが貯まして用いられる。

【0041】この未反応エチレンの回収核に行うクロム 系数様の完全失活処理の温度は、特に制限はされない が、通常、50℃以上、資ましくは85~180℃、よ り好ましくは100~130℃である。このうち反応温 度を85℃以上に保持すると、割性したポリマーが反応 生成液中に溶液は、副生したポリマーを系外へ取り出す ことなく、失活処理等の反応器、制制炉、配管、ポンプ 等の装置を詰まらせることなく、安定に失活処理を行う ことができる。この失活処理の圧力は、反応生度の以 上、好ましくは51×2/cm¹G以上である。また失活 処理時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることは できないが、過常5秒~1時間である。

【0042】このようにして酸媒を完全に失済させた後 の三量化反応に致命には、一へみそとが高いかで 含まれており、C10やC14オレフィンの関連は着し く時間されている。また灰応エナレンへの失流層のに 得も腐傷に対明され、未反応エナレンのサイクルに して、失活剤や除去に受する新たな装置の設置の必要も ない。

【0043】本発明においては、このように三量化反応 終了後、クロム系触媒に含有されるクロム化合物に対し て1モル当量以上で、しかもクロム系触媒に含有される 金属の合計モル数に対して3モル当量未満の失活剤を、 反応生成液に添加してクロム系触媒に含有されるクロム 化合物を失活させた後(クロム系触媒に含有されるクロ ム化合物の失活工程)、未反応エチレンを反応生成液か ら分離し(未反応エチレンの回収工程)、次いでクロム 系触媒に含有される金属の合計モル数に対して3モル当 量以上の失活剤を反応生成液に添加して、クロム系触媒 を完全に失活させた後(クロム系伸媒の失活工程) 藤 金属の脱灰処理を行い (触媒の脱灰工程)、さらに1-ヘキセンと溶媒を蒸留(1-ヘキセンと溶媒の分留工 程)によって1-ヘキセンを分離回収する。回収された 未反応エチレン及び溶媒は必要に応じて三量化反応系に リサイクルされる。また、本反応においてはエチレンの 三量化反応により、1-ヘキセンとともに少量の炭素数 10及び14の高沸オレフィンが生成する。この高沸オ レフィンは多段形式の蒸留処理によって、所望の各種高

沸オレフィンを得ることができる。これら高沸オレフィンも必要に応じて三量化反応系に溶媒としてリサイクルしてもよい。

[0044]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いて更に詳細に 説明するが、これらの実施例は本発明の模型を示すもの で、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

実施例1

1 Lシュレンク管にマレイミド1 4.5mg(0.15 mmol) を平取り乾燥シクロヘキウン40mlに落 解させ、0.01mol/1のクロム(III) ドリス (2-エチルヘキウノエート)/シクロヘキサン溶液 5.0mlを入れ混合した、0.12mol/1のトリ エチルアルミンカン/シクロヘキナン溶液 1.0ml と0.04mol/1のエチルアルミニウムジクロリド /シアロヘキサン溶液 5.0mlの過合物を加え、変温 で1 Mm間様日に、触媒液を対理別した。

【0045】温度計、触媒溶液フィード管及び撹拌装置 を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器を90 ℃で加熱真空乾燥したのち窒素ガスで十分間換した。前 記の触媒溶液を全量容器に仕込んだ。撹拌速度を1.0 00rpmに調整し、反応容器を120℃に加熱後、反 応容器内の絶対圧力を40kg/cm²となるようにエ チレンガスを吹き込みエチレンの三量化反応を開始し た。以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これ らの反応条件を保った状態で10分反応を行なった。1 0分後、反応容器にシクロヘキサンに希釈した表1に示 す所定量の失活剤を窒素で圧入することによってクロム 系触媒に含有されるクロム化合物を失活させた。反応生 成液の一部を抜き出し、反応液中に含まれる生成物をガ スクロマトグラフィーにより分析した。その結果、2-エチルヘキサノールは含まれておらず、フラッシュによ り失活剤が同伴される懸念がないことが判った。次いで 未反応エチレンをフラッシュにより10kg/cm2G まで排出後、さらに表1に示すシクロヘキサンに希釈し た所定量の失活剤を築素で圧入することによって触媒を 完全に失活させた。

【0046】反応容器を整温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示った。

【0047】実施例2、3

表1に示す条件で反応生成液中のクロム系触媒の失活処理を行ったこと以外、実施例1と同様にして三量化反応、失活処理操作を行なった。結果を表1に示す。 【0048】実験例4

温度計、触媒溶液フィード管及び撹拌装置を備えた内容 積11.のステンレス製耐圧反応容器を90℃で加熱真空 乾燥したのち墾素ガスで十分置換した。0.01mo1

/lのクロム(III)トリス(2-エチルヘキサノエ ート) /シクロヘキサン溶液5.0ml、0.10mo 1/1の2、5-ジメチルピロール1、5m1及びシク ロヘキサン350m1を反応容器胴側に仕込み、エチレ ンで十分置換した。一方、触媒フィード管に0.50m 01/1のトリエチルアルミニウム/シクロヘキサン溶 液3.0ml、0.10mmo1/1の四塩化ゲルマニ ウム/シクロヘキサン溶液1.0m1を仕込んだ。

【0049】反応容器を120℃に加熱し、撹拌速度を 1,000rpmに調整後、触媒フィード管にエチレン を導入し、エチレン圧によりトリエチルアルミニウムと ジエチルアルミニウムクロリドの混合溶液が反応容器胴 側に導入され、エチレンの三量化反応を開始した。反応 容器内の絶対圧力を40kg/cm²となるようにエチ レンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように 導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分 間、エチレンの三量化反応を行なった。30分後、反応 容器にシクロヘキサンに希釈した表1に示す所定量の失 活剤を窒素で圧入することによってクロム系触媒に含有 されるクロム化合物を失活させた。反応生成液の一部を 抜き出し、反応液中に含まれる生成物をガスクロマトグ ラフィーにより分析した。その結果、カーブタノールは 含まれておらず、フラッシュにより失活剤が同伴される 懸念がないことが判った。次いで未反応エチレンをフラ ッシュにより10kg/cm2Gまで排出後、さらに表 1に示す所定量の失活剤を窒素で圧入することによって 触媒を完全に失活させた。

【0050】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧し た。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガス クロマトグラフィーにより分析した。 結果を表1に示 す.

【0051】実施例5

撹拌装置を備えたシュレンク管を加熱真空乾燥して、次 いで窒素ガスで十分置換したのち、0.195mo1/ 1のトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液 98.3m1を入れ、氷水浴で冷却した、氷冷下、撹拌 しながら、259mgの水をゆっくり滴下し、1時間提 拌を継続しながら保持して、0.195mol/1のイ ソプチルアルミノキサン/シクロヘキサン溶液を合成し た。

【0052】1レシュレンク管に前記0.195mol /1イソプチルアルミノキサン/シクロヘキサン溶液3 O. 8ml (A1換算6, 0mmol), 1, 2-ジメ トキシエタンO. 27g (3.0mmo1) と乾燥シク ロヘキサン550mlを入れ、次いで0,1mol/1 のクロム (III) トリス (2-エチルヘキサノエー ト)/シクロヘキサン溶液2.0mlを入れ混合し、室 温で1時間撹拌して、触媒溶液を測製した。

【0053】温度計、触媒溶液フィード管及び撹拌装置 を備えた内容積1Lのステンレス製耐圧反応容器を90 ℃で加熱真空航機したのち瓷素ガスで十分置換した。前 記の触媒溶液を全量容器に仕込んだ。撹拌速度を1,0 00 г р m に調整し、反応容器を 100℃に加熱後、反 応容器内の絶対圧力を35kg/cm2となるようにエ チレンガスを吹き込みエチレンの三量化反応を開始し た。以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これ らの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。3 0分後、反応容器にシクロヘキサンに希釈した表1に示 す所定量の失活剤を管塞で圧入することによってクロム 系触媒に含有されるクロム化合物を失活させた。反応生 成液の一部を抜き出し、反応液中に含まれる生成物をガ スクロマトグラフィーにより分析した。その結果。2-エチルヘキサノールは含まれておらず、フラッシュによ り失活剤が同伴される懸念がないことが判った。次いで 未反応エチレンをフラッシュにより10kg/cm2G まで排出後、さらに表1に示す所定量の失活剤を密案で 圧入することによって触媒を完全に失活させた。反応容 器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収 した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィー により分析した。結果を表1に示す。

【0054】比較例1

表1に示す条件で失活処理を行ったこと以外、実施例1 と同様にして三量化反応および失活処理操作を行なっ た。結果を表1に示すが、共三量化反応が進行して1-ヘキセン選択率が低下した。

[0055]比較例2

表1に示す条件で失活処理を行ったこと以外、実験例1 と同様にして三量化反応および失活処理操作を行かっ た。結果を表1に示すが、 触媒はフラッシュする前に完 全に失活しており、フラッシュ前の反応生成液をガスク ロマトグラフィーにより分析したところ、2-エチルへ キサノールが残留していた。 【0056】比較例3

表1に示す条件で失活処理を行ったこと以外、実施例1 と同様にして三量化反応および失活処理操作を行なっ た。結果を表1に示すが、フラッシュ後の触媒は完全に 失活していなかった。

[0057] 【表1】

### ##################################	EH), Cr(2-EH), 0.5 Et.Al 1.30 1.30 7744 87 11.8 6.015 12.0 0.20	Cr(2-EH) 0.05 Et.A! 1.30 47427 6.15 EtAIC! 0.20	Cr(2-BH), 0.05 EtaA! 1.50 DMP 0.15 GeC1, 0.10	Cr (2-EH), 0.20 1BAO 6.0 DME 3.0	Cr(2-EH) 0.05 EtsAl 1.30 474 g.F. 6.130 6.141 G.I. 1.20	Cr(2-EH); 0.05 EtyAl 1.30 7L/4:R 0.15 EtAICI:	Cr(2-EH); 0.05 Et,A! 1.30 71/4 R 0.15 EtAIC!;
第 1 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年	fn a mia		Cr(2-BH), 0.05 0.05 5t ₃ A! 1.50 DMP 0.15 GeCl4 0.10	Cr (2-EH); 0.20 1BAO 6.0 DME 3.0	Cr(2-EH), 0.05 EtA1 1.30 4745K 7745K 0.15 0.20	CT(2-EH), O C C E	Cr(2-EH), 0.05 EtsAl 1.30 77/8F 0.15 EtAlCI, 0.20
4巻 「中央の 「中央の 「中央の 「中央の 「中央の 「中央の 「中央の 「中央の	fr o mio		Cr(2-BH), 0.05 6taA! 1.50 DMP GeC1, 0.10	Cr(2-EH) ₃ 0.20 1BAO 0.0 0.0 0.0 3.0	Cr(2-EH), 0.05 EthAl 1.30 4L/4EK 0.120 120	Cr(2-EH), 0.05 EtyAl 1.30 71/27 0.15 EtAICI	Cr(2-EH), 0.05 Et.Al 1.41 774 % F 0.15 EtAICI, 0.20
日本の ・	n o m = 0		EtsAi DMP 1.50 DMP 0.15 GeCII	0.20 1BAO 0.20 DME 3.0	C7.2-EH), E4.A1 1.30 47.4 £ K E4.0.15 E4.1 C1,	Cr(2-EH), 0.05 1.30 77/27 6.15 EtAICI,	Cr(2-EH), 0.05 1.30 77/4 K 0.15 EtAICI, 0.20
1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1			EtsA: 1.50 DMP 0.15 GeCI4 0.10	0.20 1BAO 6.0 DME 3.0	Ethal 1.30 7/457 7/457 Ethici, 120	0.05 1.30 77/17 6.15	0.05 EtsAl 1.30 71/4K 0.15 EtAICI: 0.20
うか開発化数 用限 0 1 円をおする配合の名 用取 0 1 ア代数	0 0 10		Et.A! 1.50 DNP 0.15 GeC1, 0.10	1BAC 6.0 DME 3.0	Et.A1 1.30 71/8F 0.15 Et.AIC1, 0.20	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Et.A. 777488 00.18
日日の一 に関係とも取合の名 日日の一 フ介配 日日の一	0 0 10		1. 50 DMP 0. 15 GeC14 0. 10	0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	######################################	7 7 3 8 7 3 3 8 7 3 3 8 7 3 3	777 % K 0.15 0.15 0.20
にはなるを配合の在 田田の一 ン分配 田田の一	m = 0		DNP 0.15 GeCl4 0.10	DMG.	47487 47487 0.15 814101, 0.20	777 FF 0.15 EtAICI	77/4 K
ma o I	w.i.o.		GeC1+ GeC1+ 0.10	9 3.0	47.48.K 0.15 0.20 120	71/2F 0.15 EtAIC3	7L/3K 0.15 EtAICI, 0.20
A CAN			0.15 GeC14 0.10		0.15 EtAICI, 0.20	EtAICI.	0.15 EtA C .
1、1分割 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			GeC14 0.10 120		EtAICI. 0.20	EtAIC:	EtAIC1.
l onn			0.10	' ' '	0.20	ETAIC:	0.20
-	- 2		120	١ و	0. 20		0.20
	120	120	120	001	120	0. 20	
120		2 4	0 7 7		120		
		40	40			120	120
	0.4			25	40	90	•
東西 今 10	01	10	30	30	: :		,
東京都の第二番						:	^ -
ノラッツ山麓の大道町 2・ログエート	7-8 2-159P-19/-8	2-199A44/-8	カーノタノール	2-164465.5	9-146/3387.5	2.1004001.0	A settle and
mmo1 0.10	10 1.55	0	4			4-11-11-1	A Philadelphia
-		1 0 1					
_			2.6			106	0
ľ		6.7	3	0	0.018	es es	0.065
-	-	×	エクノール	*	2-196/44/-4		5 (MVH) 2
1110 E	_	46.5	15. 5	62.0	6.2	,	
大活乱/金金属比(もん比) 4. (30.0	30.0	10.0	0			
							7
和模技が指 wt%			_		_		
64	1 0.1		0.0	1 2			
C6 90. 8	90.0	95.3	60	9.0	0		
C8 0.3	_	ď				9	n .
					*	·	0
		· ·			20.1	7.4	7
	1. 0	6.3	0.3	1.6	8 .	1. 8	

【0058】 【発明の効果】本発明によれば、エチレンを三量化して 1~ヘキセンを製造する方法において、エチレンの三量 化反応に用いて活性なクロム系触媒を失活処理する際

に、1 ーヘキセンの選択率を低下させることなく、また 未反応エチレンに失活剤を同伴させることなく、失活処 理を行うことができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C07C	2/32		9734-4H	C07C	2/32		
	7/148		97344H		7/148		
// C07B	61/00	300		C 0 7 B	61/00	300	